Patent Abstracts of Japan



PUBLICATION NUMBER

2000077188

PUBLICATION DATE

14-03-00

APPLICATION DATE

31-08-98

APPLICATION NUMBER

10244948

APPLICANT: CANON INC;

INVENTOR:

YUKIMURA NOBORU;

INT.CL.

H05B 33/22 B41J 2/44 B41J 2/45

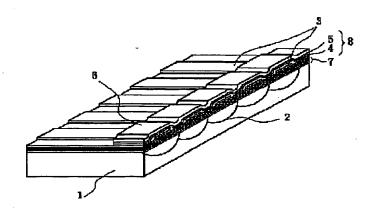
B41J 2/455 G03B 27/32 H05B 33/14

H05B 33/24

TITLE

: EXPOSURE DEVICE AND IMAGE

FORMING DEVICE



rif. GLP P2-4226

ABSTRACT :

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a small-sized photosensitive material writing device of a reduced cost with can be operated at a high speed with high definition, and simultaneously, can efficiently use light emitted from a light emitting element.

SOLUTION: This exposure device comprises, on a substrate 1, the array of light emitting elements, each of which is composed of at least an anode layer 3, a cathode layer 6 and one or a plurality of organic compound layers 8 sandwiched between the layers 3 and 6. The array of the light emitting elements includes micro lenses 2 and translucent reflection layers 7 on the substrate 1. A micro light resonator structure is configured between the translucent reflection layer 7 and the cathode layer 6. The exposure device has a light emitting peak within the half width range of a sensitivity to a wavelength of a photosensitive body which is exposed to light by the exposure device.

COPYRIGHT: (C)2000, JPO

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出職公開番号 特開2000-77188

(P2000-77188A)

(43)公開日 平成12年3月14日(2000.3.14)

(51) Int.CL'		識別記号		FI				チーマコード(参考)
H05B	33/22			H05B	33/22		Z	
B41J	2/44			G03B	27/32		. 2	
	2/45			H05B	33/14		Α	:
	2/455				33/24			
G03B	27/32			B41J	3/21		L	
			象館登審	未菌求 前江	契項の数10	OL	(全 14 頁)	最終頁に続く

(21)出顧番号 特顧平10-244948 (71)出顧人 000001007 キヤノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ ノン株式会社内 (72)発明者 上野 和則 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ ノン株式会社内 (74)代理人 100096828 弁理士 接辺 数介 (外1名)

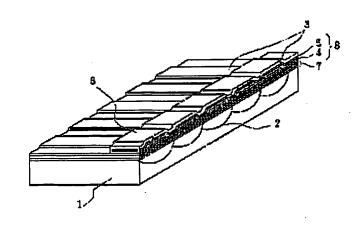
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 露光装置及び画像形成装置

(57)【要約】

【課題】 高速、小型、低コスト、高精細であると同時 に発光素子の発光した光量を効率よく利用可能な感光材 料書込み装置を提供する。

【解決手段】 基板1上に、少なくとも陽極層3及び陰極層6と、これらの間に決持された一層または複数層の有機化台物層8より構成される発光素子アレイを有する露光装置であって、該発光素子アレイが、基板1にマイクロレンズ2を有しており、更に半透明反射層7を有して該半透明反射層7と陰極層6間で微小光共振器構造を形成し、かつ、該露光装置により露光される感光体の波長に対する感度の半値幅域内に発光ビークを有する露光装置。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に、少なくとも陽極層及び陰極層と、これらの間に挟持された一層または複数層の有機化台物層より構成される発光素子アレイを有する躍光装置であって、該発光素子アレイが、基板にマイクロレンズを有しており、更に半透明反射層を有して該半透明反射層と陰極層間で微小光共振器構造を形成しており、かつ、該露光装置により露光される感光体の波長に対する感度の半値幅域内に発光ビークを有することを特徴とする露光装置。

1

【語求項2】 マイクロレンズが、発光部と1対1対応であることを特徴とする語求項1に記載の選光装置。

【請求項3】 マイクロレンズの関口部面積が、発光部の面積より大きいことを特徴とする請求項1または2に記載の露光装置。

【請求項4】 マイクロレンズの焦点距離が、発光部とその発光部に対応するマイクロレンズ間の距離よりも短いことを特徴とする請求項1~3に記載の露光装置。

【請求項5】 マイクロレンズが、発光部に対応する部分の基板をイオン交換することにより形成されることを 25 特徴とする請求項1~4に記載の選光装置。

【請求項6】 マイクロレンズが、発光部に対して凸レンズ形状を有するマイクロレンズであることを特徴とする請求項1~5に記載の露光装置。

【語求項7】 マイクロレンズが、基板の有機化合物層が形成される側と同一側の面に形成されているととを特徴とする請求項1~6に記載の露光装置。

【請求項8】 マイクロレンズが、基板の有機化合物層が形成される側と反対側の面に形成されていることを特徴とする請求項1~7に記載の選光装置。

【請求項9】 半透明反射層が陽極層と接していることを特徴とする請求項1~8に記載の露光接置。

【請求項10】 請求項1~9に記載の選光装置と、該 選光装置により選光される感光体とを少なくとも有する ことを特徴とする画像形成装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は複写機、プリンタ等の電子写真装置に用いる電光装置及び画像形成装置、特に光ブリンタへっドに関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来より、感光体上に潜像を書き込むための露光方式としてレーザービーム方式、LEDアレイ方式などが中心となっている。

「ひひひりしょみ」 かれた コニギニレニテモゴル経

り出したチップを並べる必要がある。そのときにチップ 間の段差、間隔が問題となる。

【①①①5】また、感光体上に結像するためにロッドレンズアレイが必要であるが、拡散光をロッドレンズアレイで結像しようとした場合。ロッドレンズアレイの光入射効率が低く、発光素子の発光した光を効率よく利用することができない。従って、感光体上で必要な光量を得るためには、発光素子を必要以上に発光させなくてはならなかった。

10 【0006】更に、通常の有機発光素子の発光波長は半 値幅が100nm程度と広いため、感光体の感度ビーク と合わない光量成分もあり効率的ではなかった。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記従来の問題を解決し、高速、小型、低コスト、高精細であると同時に発光素子の発光した光量を効率よく利用可能な選光装置及び画像形成装置。特に光フリンタヘッドを提供するととを目的とする。

1000081

【課題を解決するための手段】本発明の選光装置は、基板上に、少なくとも陽極層及び陰極層と、これらの間に挟持された一層または複数層の有機化合物層より構成される発光素子アレイを有する選光装置であって、該発光素子アレイが、基板にマイクロレンズを有しており、原に半透明反射層を有して該半透明反射層と降極層間で微小光共振器構造を形成しており、かつ、該選光装置により選光される感光体の波長に対する感度の半値幅域内に発光ビークを有することを特徴とする。

[0009]更に、本発明の画像形成装置は、上記套光 30 装置と、該套光装置により電光される感光体とを少なく とも有することを特徴とする。

[①①1①] とのような構成をとることにより、高速、小型、低コスト、高精細であると同時に発光した光を効率よく利用できる露光装置、具体的には光ブリンタヘッド等を提供することが可能である。

[0011]

【発明の実施の形態】以下、本発明を図面を用いて詳細 に説明する。

[()()()(2) 図1は本発明の露光装置である発光素子ア 40 レイの一例を示す斜視図である。

【0013】図1において、1は基板、2はマイクロレンズ、3は透明電極である陽極層、6は陰極層、7は半透明反射層、8は正孔輸送層4及び電子輸送層5より構成される有機化合物層であり、陽極層3と陰極層6間に無圧を6mmでよりにより、陽極層3と陰極層6間に

発光部と1対1対応に形成されている。

【①①15】との際、発光した光を効率よく利用するた めには、マイクロレンズ2の関口部面積が発光部の面積 よりも大きい方が好ましい。また、光量を効率的に得る ためには、マイクロレンズ2の焦点距離が、発光部とそ の発光部に対応するマイクロレンズ2間の距離よりも短 い方が好ましい。

【①①16】マイクロレンズ2は図1に示すものに限定 されるものではなく、発光部からの発光を集光できるも ロレンズ2が 発光部に対して凸レンズ形状を有するマ イクロレンズであるが、凹レンズ形状を有するマイクロ レンズとしてもよい。また、図1においては、マイクロ レンズ2が、基板1の有機化合物層8が形成される側と 同一側の面に形成されているが、マイクロレンズ2を、 基板1の有機化合物層8が形成される側と反対側の面に 形成してもよい。

【①①17】また、発光素子アレイは、半透明反射層7 と陰極層6間で微小光共振器構造を形成している。この なくすることが可能となる。また、発光波長の半値幅を 狭くすると同時にピーク波長の出力を強めることができ るので、発光光量を効率よく利用することが可能となる

【0018】更に、発光索子アレイは、蘇光される感光 体の波長に対する感度の半値幅域内に発光ピークを有す る。このため、良好な画像を得られ、駆動電圧を低くす ることができ、素子寿命を長くできる。

【10019】華飯1としては、発光素子、マイクロレン ズを表面に構成できるものであればよく、例えばソーダ 30 材料を用いることができる。 ライムガラス等のガラス、樹脂フィルム等の透明絶縁性 基板を用いるのが好ましい。

【① ① 2 ① 】半週期反射層7としては、特定の数長の反 射透過率を高くまたは低くすることができる構成であれ ば特に限定されず、例えば、材質、厚み等により屈折率 が異なる複数の層を補層したものが好ました。半透明反 射層?を形成する材料としては、例えば、SIOz、T 10,等が挙げられる。

【①①21】陽極層3の材料としては仕事関数が大きな ものが延ましく、例えばITO、酸化鋁、金、白金、パ ラジウム、セレン、イリジウム、ヨウ化銅などを用いる のであればよい。具体的には、図1においては、マイク 10 ことができる。一方、陰極層6の材料としては仕事関数 が小さなものが望ましく。例えばMg/Ag、Mg、A 1. しょ、「nあるいはこれらの台金等を用いることが できる。

> 【①①22】有機化合物層8は、一層構成であっても良 いし、複数層構成であっても良く、例えば図1に示すよ うに、陽極層3から正孔が注入される正孔輸送層4、及 び陰極層6から電子が注入される電子輸送層5からな り、正孔輸送層4と電子輸送層5のいずれかが発光層と

なる。また、蛍光材料を含有する発光層を正孔輸送層 4 ため、光の拡散が抑えられ、露光スポットの広がりを少、20 と電子輸送層5との間に設けても良い。また、混合一層 構成で正孔輸送層4, 電子輸送層5、発光層を兼ねた標 成も可能である。

> 【0023】有機化合物層8の材料は、使用する感光ド ラム等の感光材料と感度のあったスペクトル発光をする ものを選択することが望ましい。

> 【0024】正孔輸送層4としては、例えば、N、N -ビス (3-メチルフェニル) - N、N'-ジフェニル -(1, 1] - ピフェニル) - 4, 4' - ジアミン(以下TPD)を用いることができ、その他にも下記の有機

[0025]

[{t 1]

ホール輸送性化合物

ホール斡送体

5

[0026] [化2]

ホール輸送性化合物

30

40

[化3]

[0028] [化4]

10

30

20

ホール輪遊性化合物

$$C_2H_1 \longrightarrow CH = N - N$$

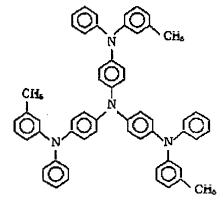
30

40

[0029] [化5]

ホール輸送性化合物

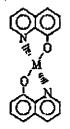
9



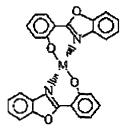
CH.

堂子榆英性化合物

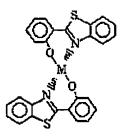
M: Al, Ga



M: Zn, Mg, Be



M: Zn, Mg, Be



M: Zn. Mg. Be

[0033] [化?]

[0030]また、例えばa-Si. a-SiCなどの 危機材料を用いてもよい。

「ひひり」「金工料法庫によ」がは、例えば

$$CH^{2}-C - CH^{2} -$$

$$CH = CH - N$$

[0034] [化8]

NE LIS, M. A. SE.

10

20

30

特闘2000-77188 14

<u>1</u>3

電子輸送性化合物

$$\bigcirc CH = CH - \bigcirc CH -$$

【0036】また、以下に示されているようなドーパンド色素を電子輸送層5、あるいは正孔輸送層4にドーピングすることもできる。

[0037]

[(£10]

ドーパンド色素

【0038】各層の膜厚等は、特に限定されないが、感光体と感度の合ったスペクトルを取り出せるように最適化することが望ましい。

【0039】尚、逆の補屠順、即ち墓板上に陰極層、有 機化合物層、陽極層、半透明反射層を順次補層し、最後 30 にマイクロレンズを形成して発光素子アレイを構成して もよい。

【①①4①】以下、本発明の発光素子アレイの作製工程の一例を図2に沿って説明する。

【① 0 4 1 】a) マイクロレンズ2の作製(図2(a))

マイクロレンズ2は、発光部に対応する部分の基板 1 を イオン交換することにより形成することができる。

[0042]まず、基板1の両面を十分に洗浄する。次に、基板1全体をTiなどのイオン非透過性の膜によっ 40でマスクする。イオン拡散面のTiにフォトリソエッチング法により所望の直径、中心間隔で開口部列を形成する。この基板をイオン交換処理を行うため、例えばTiNO,とKNO。の混合溶融塩、Ag*、Tiなどの硝酸 電 環際組みとの検証機とは、Ag*、Tiなどの硝酸

ストを用いる方法、レブリカ法等により形成してもよ い。

【① ① 4 5 】 b)図2(b)に示すように、マイクロレンズ2の形成された面上にスパッタ法により、複数層よ) りなる半透明反射層7を形成する。

【①①46】c)図2(b)に示すように、マイクロレンズ2に対応する部分に陽極層3がのるように、ライン幅、ビッチを調整して金属マスクを被せて、スパッタ法により所定の厚さに陽極層3を形成する。

[① ① 4.7] d)図2(d)に示すように、正孔輸送層4、電子輸送層5を順次真空蒸着法により蒸着する。

[0048]e)図2(e)に示すように、所望のライン帽の金属マスクをマイクロレンズ2の列に重なるようにして彼せ、除極層6を形成する。

【()()49】本発明の画像形成装置の一例として、電子写真方式を用いた画像形成装置の機略構成図を図3に示す。

【① 050】211は像担持体としての回転ドラム型の 電子写真感光体 212は帯電手段 213は現像手 晩 214は転写手配 215は完美手配 215は2

2 1 1 上に結像させることができ、良好な画像を得ることができる。

17

[10052] 感光体211上を帯電手段212により一様に帯電する。この感光体211の帯電面に対して出力される目的の画像情報の時系列電気デジタル画素信号に対応して露光装置による露光しがなされ、感光体211の周面に対して目的の画像情報に対応した静電潜像が形成される。その静電潜像は絶縁トナーを用いた現像手段213によりトナー像として現像される。一方、結紙部(不図示)から記録材としての転写材りが供給されて、感光体211と、これに所定の押圧力で当接させた接触転写手段との圧接ニップ部(転写部)Tに所定のタイミングにて導入され、所定の転写バイアス電圧を印加して転写を行う。

【0053】トナー画像の転写をうけた転写材Pは感光体211の面から分離されて熱定者方式等の定着手段215へ導入されてトナー画像の定者をうけ、画像形成物(プリント)として装置外へ排出される。また転写材Pに対するトナー画像転写後の感光体面はクリーニング手段216により残留トナー等の付着汚染物の除去をうけ 20 て清掃され繰り返して作像に供される。

[① ① 5.4] 本発明の画像形成装置の他の例として、電子写真方式を用いた多色画像形成装置の機略構成図を図4に示す。

【0055】C1~C4は帯電手段、D1~D4は現像手段、E1~E4は本発明の選光手段、S1~S4は現像スリープ、T1~T4は転写プレード、TR1~TR2はローラ、TF1は転写ベルト、Pは転写紙、F1は定着器、301~304は回転ドラム型の電子写真感光体である。

【0056】転写紙Pは矢印方向に搬送され、ローラTR1、TR2に懸架された転写ベルトTF1上に導かれ、転写ベルトTF1により感光体301と転写ブレードT1に挟続されるように設定されたブラック転写位置へと移動する。との時、感光体301はドラム周上に配置された、帯電手段C1、変光手段E1、現像手段D1の現像スリーブS1により電子写真プロセスにより所望のブラックのトナー画像を有していて、転写紙Pにブラックトナー画像の転写が行われる。

【①①57】転写紙Pは転写ベルトTF1により、感光 40体302と転写ブレードT2に挟持されるように設定されたシアン転写位置、感光体303と転写ブレードT3に挟持されるように設定されたマゼンタ転写位置、感光体304と転写ブレードT4に挟持されるように設定されたフェロー転写位等人上移動し、それぞれの転写位等

レーションが良好に行える。以上のプロセスにより多色 記録を行った転写紙Pは定着器F1に供給され定着を行 い所望の多色画像を得ることができる。

[0059]

【実施例】(実施例1)図2に示す手順で図1に示す発 光素子アレイを作製した。

【① ① 6 ① 】透明絶縁性の基板 1 は各発光部に対応した 部分にイオン交換法によりマイクロレンズ2が形成され ており、その上には誘電層 7、陽極層 3、正孔輸送層 4 発光層を筆わた電子輸送層 5 そして降極層 6が續

10 4 発光層を兼ねた電子輸送圏5、そして降極層6が補屋されている。

【①①61】まず、基板1のマイクロレンズ2の作成方法について説明する。

【①①62】本実施例では、透明絶縁性の基板1として ソーダライムガラス基板を用いた。このガラス基板の両 面を十分に洗浄する。

【①①63】次に、ガラス基板全体を T_1 膜によってマスクする。イオン拡散面の T_1 にフォトリソエッチング法により直径30 μ mで中心間隔が80 μ mの開口部列を形成する。

[0064] この基板をイオン交換を行うためT1NO。とKNO,の混合溶融塩に浸し、直径がほぼ70μmの半球状の屈折率領域(マイクロレンズ)2を形成する。 [0065] 次に、発光素子アレイの作成方法について説明する。

[0066] マイクロレンズ2の形成された面上にスパッタ法により、層厚93nmのSiOx層21及び層厚59nmのTiOx層22を交互に積層し、半透明反射層2を形成する。

G 【0067】次に陽極圏3として「TOを形成する。マイクロレンズ2に対応する部分に「TOがのるように、ライン幅50μm、ピッチ80μmの金属マスクを被せてITOをスパッタ法により60nm形成する。

[0068]次に、正孔輸送層4としてTPDを、電子 輸送層5としてAlq」を順次真空蒸着法によりそれぞ れ40nm、50nm蒸着する。なお、蒸着時の真空度 は2~3×10⁻²Torrであり、成膜速度は0.2~ 0.3nm/sとした。

[0069]最後に、ライン幅40μmの金属マスクを 院極層2と直交し、マイクロレンズ2の列に重なるよう にして被せ、陰極層6としてMgとAgと10:1の蒸 着速度比で共蒸着し、Mg/Agが10/1の合金を2 00nm形成する。このとき、成膜速度は1nm/sと した。

「ひのてのしっ ノカロしい、70 の間口本語は数半部の南

!TO電極とMg/Ag電極が交差している部分から緑色の発光が得られた。

19

【①①73】図5に示すように、実施例1の発光素子アレイは、感光体の感度の半値幅域内に発光ピーク液長を 10 有し、良好な画像を得ることができた。一方、比較例の発光素子アレイは、発光ピークが感光体の感度の半値幅域内にはないため、感光体の電位を所望の電位まで下げることができず、画像がぼけてしまい良好な画像を得ることができなかった。

【①①74】更に、発光ビーク波長の異なる数種類の発光素子アレイを作製し、画像出力を行ったところ。良好な画像を得るためには、少なくとも感光体の感度の半値幅域内に発光ビーク波長を有することが必要であった。感光体の感度の半値幅域内に発光ピーク波長を有さなくても駆動電圧を高くすることで良好な画像を得られるようになるが、この場合には素子寿命が短くなるという問題が生じて好ましくない。

【0075】との様にマイクロレンズ及び光共振器構造を有する発光素子アレイを用いることで、光の鉱散が抑えられ、露光スポットの広がりを少なくすると同時にマイクロレンズにより感光体上に結像することが可能となった。また、発光波長の半値幅を狭くすると同時にピーク波長の出力を強めることができるので、発光光量を効率よく利用することが可能となった。

【0076】本実施例においては、300dpiの発光 素子アレイを作成したが、電極幅を変更することで、任 意の大きさの発光点を得ることが可能である。

[10077] (実施例2) 図6は本実施例の発光素子アレイの断面図である。

【①①78】基板1してのガラス基板には各発光部に対応した部分に凸レンズ形状を有するマイクロレンズ24が形成されており、その上には半透明反射層7.陽極層3.正孔輸送層4、発光層を兼ねた電子輸送層5.そして陰極層6が積層されている。

【① ① 7 9 】まず、ガラス基板上のマイクロレンズ2 4 の作成方法について説明する。

直径70 μmで中心間隔が80 μmになるように、フォトレジスト層をリフトオフ法やドライエッチング法等のパターン形成法を用いてパターニングする。このパターニングされたフォトレジストをアニーリングによって、軟化、流動化させ、円弧状のマイクロレンズ24を形成する。

20

【① ① 8 2 】次に、実施側 1 と同様にして半透明反射層 7 を形成した後、マイクロレンズ2 4 に対応するように、ライン幅5 ① μ m、ビッチ8 ① μ m の金属マスクを 彼せて陽極層 3 として | T O をスパッタ法により 6 ① n m 形成する。

【① 0 8 3】次に、実施例1と同様に正孔輸送層4としてTPDを、電子輸送層5としてA1q」を順次真空蒸着法により蒸着する。なお、蒸者時の真空度は2~3×10°であり、成膜速度は0、2~0、3 n m/s とした。

[0084]最後に、ライン幅40μmの金属マスクをマイクロレンズ24の列に重なるようにして被せ、陰極層6としてMgとAgを10:1の蒸着速度比で共蒸着 し、Mg/Agが10/1の台金を200nm形成する。このとき、成膜速度は1nm/sとした。

【①①85】とのようにして得られた発光素子アレイに 駆動用ドライバを接続し、電子写真用の光源として用い た。実施例1と同様に「TO電極とMg/Ag電極を交 差している部分から緑色の発光が得られ、半透明反射層 7、マイクロレンズ24を通して感光ドラム面上に結像 させることができ、良好な画像を得ることができた。

[① 0 8 6] との様に、発光素子アレイに光共振器構造 を持たせることにより、低電力で高額細な画像が得られ 30 る光ブリンタヘッドの実現が可能となった。

【① 0 8 7 】 (実施例3) 図8 に示す手順で図7 に示す 有機しEDアレイを作製した。

[0088] 基板1としてのガラス基板上には各発光部に対応した部分に凸レンズ形状を有するマイクロレンズ25が形成されており、基板1に対しマイクロレンズ25と反対側の面に半透明反射層7、陽極層3、正孔輸送層4 発光層を兼ねた電子輸送層5 そして陰極層6が 積層されている。

[①089]まず、ガラス基板上のマイクロレンズ25 46 の作成方法について説明する。図8(a)に示すよう に、マイクロレンズ25はレブリカ法により関口部の直 径が75μm、中心間隔が80μmのアレイを形成す る。そして、実施例1と同様にしてマイクロレンズ25 と反対側の面に半透明反射層7を形成する。

「ひひひひし頭り チャンかデオ推げ、 ラノカロしいがり

<u>71</u>

と同様に正孔輸送層4としてTPDを、電子輸送層5と してA!a゚を順次真空蒸着法により蒸着する。

【()()92】最後に、図8(d)に示すように、ライン 幅40μmの金属マスクをマイクロレンズ25の列に重 なるようにして彼せ、陰極層6としてMicとAgを1

0:1の蒸者速度比で共蒸着し、Mg/Agが10/1 の合金を200 nm形成する。

【①①93】このようにして得られた有機LEDアレイ に駆動用ドライバを接続し、電子写真用の光源として用 いることで、良好な画像が得ることができた。

[0094]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 高速、小型、低コスト、高精細であると同時に発光素子 の発光した光量を効率よく利用可能な光ブリンタヘッド。 等の露光装置及び画像形成装置を提供することが可能と なる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の発光素子アレイの一例を示す斜視図で ある。

【図2】本発明の発光素子アレイの作製工程の一例を示 20 8 有機化合物層 す図である。

【図3】本発明の画像形成装置の一例を示す機略構成図※

*である。

【図4】本発明の画像形成装置の他の側を示す概略構成 図である。

【図5】実施側1の感光体の分光感度と発光素子アレイ の発光波長の関係を示すグラフである。

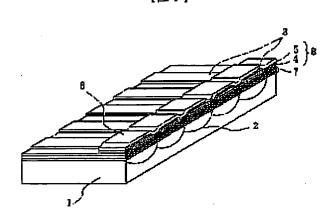
【図6】 実施側2における発光素子アレイを示す断面図 である。

【図?】実施例3における発光素子アレイを示す断面図 である。

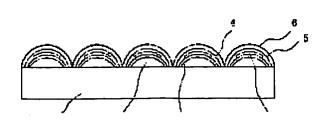
10 【図8】 実施側 3 における発光素子アレイの作製工程を 示す図である。

【符号の説明】

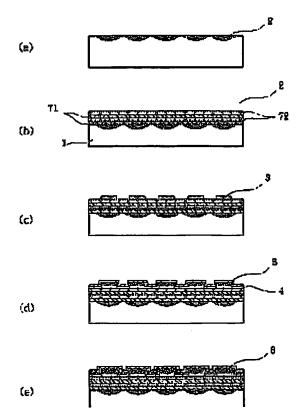
- 1 基板
- 2. 24. 25 マイクロレンズ
- 3 陽極層
- 4 正孔勒送層
- 5 電子輸送層
- 6 陰極層
- 7 半透明反射層
- 71 S:O. 愿
- 72 T ! O2厘

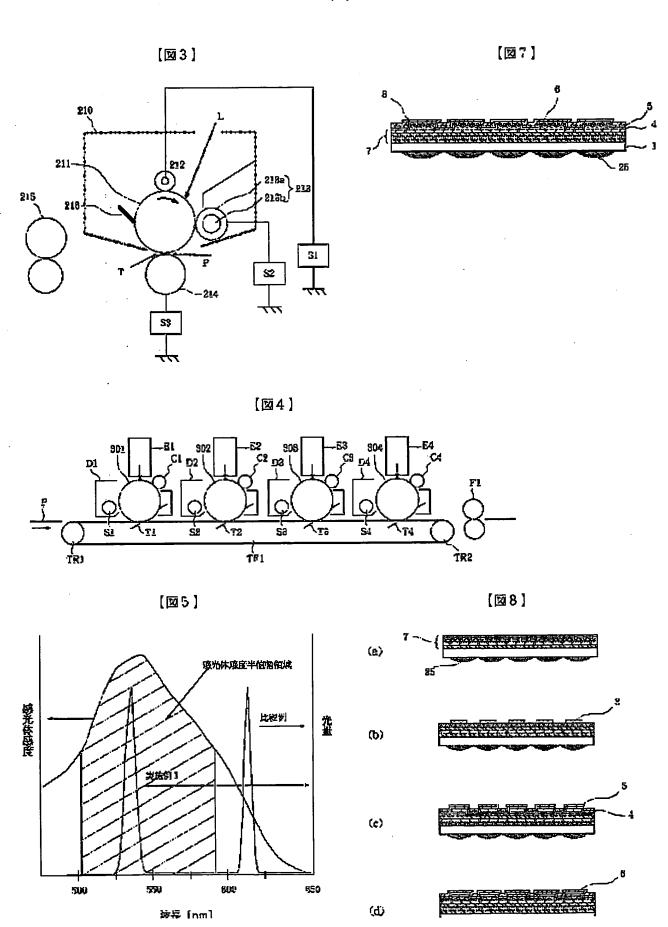


[図6]



[22]





フロントページの続き

(51) Int.Cl.'

識別記号

F !

テーマコード(参考)

(72)発明者 妹尾 章弘

H 0 5 B 33/14

33/24

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャ

ノン株式会社内

(72)発明者 橋本 雄一

東京都六田区下丸子3丁目30番2号 キャ

ノン株式会社内

(72)発明者 永雄 幸雄

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ

ノン株式会社内

(72)発明者 幸村 昇

東京都六田区下丸子3丁目30番2号 キャ

ノン株式会社内